

2026 年 07 月 23 日

各 位

J X 金属株式会社

韓国JX金属における半導体用スパッタリングターゲットの加工能力増強について

J X 金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、当社グループの韓国拠点である韓国 J X 金属株式会社（代表理事：前川 貴誠、以下「韓国 J X 金属」）において、半導体用スパッタリングターゲットの加工能力を増強するため、約 40 億円の設備投資を実施することを決定しましたので、お知らせいたします。

当社グループの半導体用スパッタリングターゲットは、最先端ロジックや、HBM・3D-NAND などの最先端メモリをはじめとする各種半導体デバイスの製造に用いられており、業界トップのシェアを有しています。

韓国 J X 金属は、先端半導体産業の集積地である韓国において、半導体用スパッタリングターゲットの下工程（加工工程）を担っています。営業・技術サポート部門を併設し、顧客に近い場所から機動的な提案と安定供給を実現しており、長年にわたり韓国国内のエレクトロニクス産業の発展に貢献してまいりました。現在、韓国においては、AI データセンター市場の拡大を背景とした最先端メモリを中心とした半導体市場の拡大が著しく加速しています。これに伴い、韓国 J X 金属が担う役割はますます重要となっています。

このような事業環境のもと、今般、需要の拡大に確実に対応し、顧客への安定供給体制を強化するため、同拠点における加工能力を増強することを決定いたしました。本投資では、当社グループが日本国内外の各拠点で実績を積み重ねてきた自動加工機を導入するとともに、これに付随する設備を一体的に整備し、2027 年度下期から段階的に稼働を開始する予定です。これにより同拠点の加工能力は 2025 年度比約 2 倍となります。

また、韓国においては、先端半導体産業の中長期的な成長が見込まれており、今後の需要動向を踏まえながら、更なる生産能力増強についても検討してまいります。

なお、当社グループでは、2026 年 6 月に台湾拠点における同製品の加工ラインの自動化投資を発表した^{※1}ほか、米国アリゾナ州の拠点においても需要動向に応じ同製品の加工能力を拡大する方針^{※2}を掲げています。また日本国内では、ひたちなか薄膜材料工場（茨城県ひたちなか市）における生産設備の増強を進めています^{※3}。今後も、原料調達からリサイクルまでの一貫したサプライチェーンの強靱化を進め、世界各地の半導体産業集積地における需要の増加を的確に捉えた供給力強化を進めることで、顧客からの信頼に応えてまいります。

今後も当社グループは、「2040 年 J X 金属グループ長期ビジョン」のもと、半導体をはじめとする先端技術の進化を支える先端材料の安定供給を通じて、社会の発展と革新に貢献してまいります。

以 上

※1 詳細は 2026 年 6 月 1 日付プレスリリース「[台湾日鉱金属における半導体用スパッタリングターゲット加工ラインの自動化投資について](#)」をご覧ください。

※2 詳細は 2024 年 11 月 25 日付プレスリリース「[米国アリゾナ州で半導体材料工場の開所式を実施](#)」をご覧ください。

※3 詳細は 2026 年 3 月 10 日付プレスリリース「[ひたちなか新工場における半導体用スパッタリングターゲットの増産に向けた 設備投資（固定資産の取得）に関するお知らせ](#)」をご覧ください。



韓国 J X 金属株式会社

＜参考情報＞

韓国 J X 金属株式会社について（2026 年 7 月 23 日現在）

会社名	韓国 J X 金属株式会社
所在地	大韓民国京畿道平澤市青北面閑山路 54
代表理事	前川 貴誠
資本金	2,400 百万ウォン
事業内容	スパッタリングターゲットの加工販売